

VS-006 <Invited Talk>

## 반도체 및 디스플레이 공정에서 발생하는 오염입자 측정을 위한 PBMS (Particle Beam Mass Spectrometer) 개발

윤석래<sup>1</sup>, 이규찬<sup>1</sup>, 김태성<sup>2</sup>, 김동빈<sup>2</sup>, 강상우<sup>3</sup>, 박명수<sup>3</sup>

<sup>1</sup>주식회사 이엘, <sup>2</sup>성균관대학교 기계공학부, <sup>3</sup>한국표준과학연구원 진공센터

본 개발은 반도체 또는 디스플레이 공정상의 불량률을 최소화 하기 위하여 시작 되었다. PBMS를 이용하여 공정상에 발생하는 오염입자들을 모니터링하고자 하였으나 기존의 시스템은 크기, 감도, 교정등의 문제들로 현장적용에 무리가 있었던 것이 사실이다. 주식회사 이엘은 PBMS의 문제들을 개선 또는 제거하여 현장에 적용 가능하도록 하였으며 전용 프로그램을 개발하여 사용자의 편의성을 증대 하였다.

**Keywords:** PBMS, 입자, 입자크기, 입자분포, 공정진단, 반도체, 디스플레이